## 北京工业大学《半导体器件原理》

## 2014-2015 学年第 2 学期考试试卷 A 卷

考试1						考试形式:	11	<u>卷</u>				
7. 14		适用专	业:	电子	科字与	技术						
承诺:		ツコフ	//小六	工业士	当	£aad\	北岸	5 T JU-	上兴兴井	生纪员	、八夕布	
本人已学习了《北京工业大学考场规则》和《北京工业大学学生违纪处分条例》,承诺在考试过程中自觉遵守有关规定,服从监考教师管理,诚信考试,做到不违纪、不作弊、												
不替考。若有违反,愿接受相应的处分。												
	J		<i>**</i>		, , , ,							
承诺人:			学号:			班号:						
				,								
注:本试卷共 4 大题,共 3 页,满分 100 分,考试时必须使用卷后附加的统一答题纸和草												
稿纸。请将答案统一写在答题纸上,如因答案写在其他位置而造成的成绩缺失由考生自己负责。												
<b>Д</b> •												
				卷面成	绩汇总	表(阅卷教	如师:	填写)				
题号	_	=	三	四	五	六十	1	八	九	+		总成
												绩
满分	10	20	40	30								
得分												
得分												
1. 本门课程介绍的4种类型晶体管分别为:,,,,,,,,,,												
和。												
2. PN 结电击穿按产生机制分为:, 和。PN 结电容包括:												
		¥π										
		_ ,和		°								
3. 用平面工艺制造 PN 结二极管芯片的工艺包括,,,												
		_ ,		等	0							
4. 在 PN 结开关管中,在外加电压从正向变为反向后的一段时间内,会出现一个较大的反												
向电流。引起这个电流的原因是存储在												
消失途	途径有两	5条,即	J		和	0						
5. 双极结型晶体管的开关时间可以分别定义为:												

时间,时间。									
得分 二、名词、符号解释题(前 1	) 题每题 1 分,后 5 题每题 2 分,共 20 分)								
1. 基区渡越时间									
2. MOSFET									
3. β (or hfe)									
BV <sub>CEO</sub>									
5. I <sub>CEO</sub>									
	BJT 的截止状态								
7									
8. t <sub>s_</sub>									
9. r <sub>b</sub>									
10. I <sub>DSAT</sub>									
11. Early 效应									
12. 跨导									
13. G <sub>MAE</sub>									
14. 沟道长度调制效应									
15. 沟道电导调制效应									
	▼								
得分									
三、作图、简答题: (每题 10 分, 共 40 分)									

1. 画出单发射极条、双基极接触光刻版制作的 Si N → PN 外延平面 BJT 芯片主要工艺步骤的 平面图和所对应的剖面图。(10 分)(可忽略 SiO₂ 台阶)

(此题做在答题纸上)

2. 分别画出均匀基区 NPN 晶体管在放大状态、饱和状态和截止状态时的能带图。(10 分)

- 3. 画出 n 沟耗尽型 MOSFET 转移特性曲线、并标出阈值电压 V<sub>T</sub>, 画出其输出特性曲线, 并标出 V<sub>SS</sub> 值、临界饱和线、非饱和区、饱和区,给出 V<sub>DSAT</sub>, I<sub>DSAT</sub>的表达式。(10 分)
- 4. 在 npn 开关双极晶体管的输出特性曲线上标出延迟时间,并通过开关过程中少子的分布 图来说明延迟时间存在的原因。(10 分)

得分

四、推导、计算题: (每小题 10 分, 共 30 分)

- 1. 高频晶体管的 β  $_{\circ}$ =80, 当信号频率 f 为 25MHZ 测得 β =6, 求晶体管的特征频率  $f_{\tau}$ , 以及 当信号频率 f 分别为 10MHZ 和 50MHZ 时的 β 值。(10 分)
- 2. N PN 双极结型晶体管在正向有源区工作时的基区少数载流子分布为  $n_{pB}(x) = n_{pB}(0) (1-x/W_B)$ ,基区渡越时间为:  $\zeta_{g} = Q_B$  /  $I_{nB}$ 。试推导出  $\zeta_{g} = W_B^2/2D_{nB}$ 。(10 分)(给出详细的推导步骤,依此评分)
- 3. 有一 n 沟道的 MOSFET,其衬底为 P 型 Si,  $N_a$ =1.  $5x10^{16}$  cm<sup>-3</sup>,栅金属为 Al,  $\Phi_{ns}$ =  $-(0.59+\Psi_F)(V)$ ,栅 Si  $0_2$  厚度  $t_{ox}$ =345Å,并具有  $Q_{ox}$ = $1x10^{11}$  q · cm<sup>-2</sup>,试计算当  $V_{BS}$ =0 时的阈值电压  $V_T(0)$ ,问该 MOSFET 是增强型还是耗尽型。 提示: q=1.  $6x10^{-19}$  c, KT/q=0. 026V,  $\epsilon_0$ =8.  $85x10^{-14}$ F/cm,  $\epsilon_{ox}$ =3. 9,  $\epsilon_{si}$ =11. 7, $N_i$ =1.  $5x10^{10}$  cm<sup>-3</sup> (10 分)(写出详细公式及计算步骤,依此评分)